ポリスチレン吸着層表面における 感圧接着テープの剥離特性

令和3年度 修士論文 三重大学大学院工学研究科 博士前期課程 分子素材工学専攻

越須賀 航平

目次

第1章	序論		
1-1	緒言		•••5
1-2	参考文献		•••7

第2章 ポリスチレン(PS)吸着層の作製と評価

2-1 試料	와	•••10
2-1-1	ポリスチレン(PS)	
2-1-2	トルエン	
2-1-3	シリコン基板	
2-1-4	ピラニア溶液	
2-1-5	フッ酸溶液	
2-1-6	超純水	
2-2 装置		· · · 12
2-2-1	スピンコーター	
2-2-2	真空加熱乾燥機	
2-2-3	エリプソメーター	
2-2-4	原子間力顕微鏡	
2-2-5	接触角計	
2-3 実際	澰手順	•••13
2-3-1	溶液調製	
2-3-2	PS 膜の作製	
2-3-3	PS 吸着層の作製	
2-3-4	膜厚測定	
2-3-5	表面形状観察	
2-3-6	各試料の表面自由エネルギーの算出	
2-4 結果	果と考察	•••16

- 2-4-1 PS 膜および PS 吸着層の膜厚
- 2-4-2 PS 膜および PS 吸着層の表面形状の観察
- 2-4-3 PS 膜および PS 吸着層の表面自由エネルギーの算出
- 2-5 まとめ · · · 19
- 2-6 参考文献
 ・・・20

第3章 PS 吸着層上における感圧接着(PSA)テープ剥離強度の評価

3-1 緒		•••21
3-2 試料	\$	•••22
3-2-1	被着体	
3-2-2	感圧接着(PSA)テープ	
3-3 装持		•••23
3-3-1	荷重変動型摩擦摩耗試験システム	
3-3-2	力学試験機	
3-4 実際	険手順	•••24
3-4-1	PSA テープの貼付方法	
3-4-2	荷重変動型摩擦摩耗試験システムを用いた 180 度剥離試	験
3-4-3	力学試験機を用いた 180 度剥離試験	
3-5 結果	果と考察	•••27
3-5-1	荷重変動型摩擦摩耗試験システムを用いた 180 度剥離試	験の結果
3-5-2	力学試験機を用いた 180 度剥離試験の結果	
3-6 E	とめ	•••34
27 字=		

第4章 中性子反射率(NR)測定を用いた PS/粘着剤界面における界面構造の解

析

4-1 緒		•	•	• 36
4-2 試	料	•	•	• 37
4-2-1	重水素化ポリスチレン(d-PS)			
4-2-2	ポリアクリル酸ブチル(PBA)溶液			
4-2-3	シリコン基板			
4-3 装	置	•	•	• 38
4-3-1	中性子反射率計			
4-4 実	験手順	•	•	• 40
4-4-1	溶液調製			
4-4-2	d-PS 膜および d-PS 吸着層の作製			
4-4-3	膜厚測定			
4-4-4	PBA 溶液の溶媒除去			
4-4-5	d-PS 膜および d-PS 吸着層上への PBA の塗布と NR 測定	ヨセノ	レィ	う
セッ	F			
4-4-6	NR 測定			
4-4-7	表面自由エネルギーの算出			
4-5 結	果と考察	•	•	• 42
4-5-1	エリプソメーターを用いた d-PS 膜および d-PS 吸着層の胆	莫厚		
4-5-2	NR 測定			
4-6 ま	とめ	•	•	• 58
4-7 参	考文献	•	•	• 59

第5章 原子間力顕微鏡(AFM)および接触角(CA)計を用いた PSA テープ剥離面

の評価

- 5-1 緒言
- 5-2 実験手順

•••61

• • • 62

- 5-2-1 PSA テープ剥離面における表面形状の観察
- 5-2-2 フォースディスタンス(FD)カーブ測定による糊残りの評価
- 5-2-3 対水接触角測定による糊残りの評価
- 5-2-4 膜厚測定による糊残りの評価
- 5-3 結果と考察

•••63

•••82

- 5-3-1 PSA テープ剥離面の糊残りの評価
- 5-3-2 フォースディスタンス(FD)カーブ測定による糊残りの評価
- 5-3-3 対水接触角測定による糊残りの評価
- 5-3-4 膜厚測定による糊残りの評価
- 5-4 まとめ
 ・・・80

 5-5 参考文献
 ・・・81

第6章 総括

謝辞

序論

1-1 緒言

感圧接着剤(Pressure Sensitive Adhesive; PSA)は、工業¹⁾や医療^{2,3)}における様々 な分野でその用途が拡大している。PSAは、化学的性質の異なる基材に対して、 外部から軽い接着圧力(1~10 Pa)を短時間(1~5 秒)かけることで、強力な接着 剤を形成する特殊な粘弾性ポリマーであり^{4,5)}、一般的には粘着剤と呼ばれる。 粘着剤は、固体になることで接着強度を増加させる接着剤に対して、常に濡れた 状態を保ち液体と固体の両方の性質を活かして接着する^{4,5)}。そのため粘着剤は 一般的に、接着剤に比べ剥離性に優れている材料といわれている。

近年、資源回収による循環型社会の実現に向けて、様々な製品・材料に易解体 性を付与することが求められている。また、人とロボットが共存する社会の到来 に備え、一定の荷重が加わると、操作部が本体から外れるセーフティ機能により 不慮の事故を未然に防ぐ材料設計など、従来の締結部に対する概念とは全く異 なる新しい思想に基づいた材料開発が求められている。容易に剥離できる接着 材料に関して、被着体の再利用を考慮すると剥離強度の低下だけでなく接着界 面での剥離様式の制御も重要である。これまでの易解体性材料の研究例として、 接着剤に熱膨張型機能材料^{6,7)}を添加することで接着面積を制御する方法や、紫 外線(Ultra Violet; UV)硬化反応により粘着力を低下させる光応答性型粘着剤⁸⁾を 中心に、接着剤の機能化からのアプローチが多い⁹⁻¹²⁾。一方で、剥離強度の制御 を目指した被着体界面における研究例は少ないのが現状である。そこで本研究 では、被着体として特異的な凝集構造をとる有機薄膜に着目した。

有機薄膜は塗装や接着、電子材料分野など幅広い分野で応用されており、製品の小型化や軽量化だけでなく、資源の節約も期待できる材料として注目を集めている。有機薄膜の作製技術は、キャスト法や蒸着法などがあるが、平面基板上に均一な高分子薄膜を作製する技術としてはスピンコート法が広く知られている¹³。しかし、スピンコート法による急速な溶媒蒸発プロセスは、基板上の高

分子鎖に残留応力をもたらし、その残留応力がフィルムの不安定性や高分子薄 膜の特性の変化を引き起こすことも知られている¹³⁾。残留応力の緩和と鎖のコ ンフォメーションの平衡化を擬平衡状態に近づけるためには、一般的に、バルク のガラス転移温度(Glass Transition Temperature; Te)をはるかに超える温度で長時 間の熱アニールが必要である。これまでにガラス転移温度以上の熱アニール過 程で、高分子/無機固体界面に高分子鎖が吸着した層が形成し、吸着した高分子 鎖は基板との多点吸着により良溶媒中でも溶出せず、バルクと異なる分子鎖凝 集状態をとることが知られている¹⁴⁾。また、界面吸着鎖の吸着様式は古くから 提案されてきたテール・ループ・トレインからなる吸着鎖の構造モデルと一致し ていると知られている¹⁵⁾。Koga らは局在表面プラズモン共鳴(Localized Surface Plasmon Resonance; LSPR)を応用したナノプラズモン測定(Nanopulasmonic Sensing measurement; NPS)¹⁰を行うことでポリスチレン(Polystylene; PS)のバルク 層と吸着層それぞれの Tgの評価を行い、バルク層よりも吸着層の Tgが高いこと を明らかにし、X 線反射率(X-ray Reflectivity; XR)測定と分子動力学(Molecular Dynamics; MD)シミュレーション¹⁷⁾により吸着層は基板界面に高密度に充填さ れていることを明らかにした。当研究室においても、トライボロジーの観点か ら、吸着層に対する摩擦挙動の研究が進められており吸着層の低摩擦性が示さ れている ¹⁸⁾。このように、界面吸着層は、密度やガラス転移温度を中心に多く の研究が展開されている 19-34)が、吸着層を利用したテープ剥離強度の制御は達 成されておらず、その接着メカニズムも明らかにされていない。



Figure 1. 固体基板界面における界面吸着層の形成のイメージ図.

本論文では、バルクと異なる吸着層の分子鎖凝集状態に着目し、感圧接着テー プを用いた 180 度剥離試験に基づく、PS 吸着層の表面におけるテープ剥離挙動 の経時変化観察、および、接着界面の中性子反射率(Neutron Reflectivity; NR)測定 やテープ剥離面の原子間力顕微鏡(Atomic Force Microscope; AFM)観察に基づき、 分子鎖凝集状態と剥離強度の関係を議論した。

1-2 参考文献

- 1. 高橋 洋一, 接着の技術, 40, 8-12 (2020).
- 2. 笠原 剛, 接着の技術, **40**, 18-21 (2020).
- X. Chen, Y. Wang, Z. Cheng, J. Wei, Y. Shi, J. Qian, ACS Omega, 5, 16, 9408-9419 (2020)., DOI: 10.1021/acsomega.0c00491.
- Y. Urahama, *Journal of the Surface Finishing Society of Japan*, 40, 1179-1184 (1989)., DOI: 10.4139/sfj.40.1179.
- M. M. Feldstein, R. A. Siegel, *Journal of Polymer Science, Part B: Polymer Physics*, 50, 739-772 (2012)., DOI: 10.1002/polb.23065.
- C. Sato, Journal of the Adhesion Society of Japan, 39, 295-301 (2003)., DOI: 10.11618/adhesion.39.295.
- C. Sato, Journal of the Adhesion Society of Japan, 44, 136-141 (2008)., DOI: 10.11618/adhesion.44.136.
- M. Hatakei, Journal of the Adhesion Society of Japan, 42, 158-163 (2006)., DOI: 10.11618/adhesion.42.158.
- Y. Fukamoto, *Journal of the Adhesion Society of Japan*, **52**, 198-207 (2016)., DOI: 10.11618/adhesion.52.198.
- L. Gong, L. Xiang, J. Zhang, J. Chen, H. Zeng, *Langmuir*, **35**, 15914-15936 (2019)., DOI: 10.1021/acs.langmuir.9b02123.
- K. Yamamura, S. Fujii, Y. Nakamura, K. Fujiwara, S. Hisaka, Y. Urahama, *Journal of Applied Polymer Science*, **129**, 1008-1018 (2013)., DOI: 10.1002/app.38772.
- 12. M. Lamblet, E. Verneuil, T. Vilmin, A. Buguin, P. Silberzan, L. Leger, *Langmuir*, 23, 6966-6974 (2007)., DOI: 10.1021/la063104h.
- M. Iijima, Y. Takahashi, *Journal of the Vacuum Society of Japan*, **32**, 531-536 (1989)., DOI:10.3131/jvsj.32.531.
- Y. Fujii, Z. Yang, J. Leach, H. Atarashi, K. Tanaka, O.K.C. Tsui, *Macromolecules*, 42, 7418-7422 (2009)., DOI: 10.1021/ma901851w.
- M. F. Thees, J. A. McGuire, C. B. Roth, Soft Matter, 16, 5366-5387 (2020)., DOI: 10.1039/D0SM00565G.
- N. Jiang, M. Sen, M. K. Endoh, T. Koga, E. Langhammer, P. Bjoorn, M. Tsige, Langmuir, 34, 4119-4209 (2018)., DOI: 10.1021/acs.langmuir.8b00122.

- N. Jiang, J. Shang, X. Di, M.K. Endoh, T. Koga, *Macromolecules*, 47, 2682-2689 (2014)., DOI: 10.1021/ma5003485.
- 18. 西脇雄大, 三重大学工学部卒業論文 (2019).
- C. Housmans, M. Sferrazza, S. Napolitano, *Macromolecules*, 47, 3390-3393 (2014)., DOI: 10.1021/ma500506r.
- X. Li, X. Lu, *Macromolecules*, **51**, 6653-6660 (2018)., DOI: 10.1021/acs.macromol. 8b01141.
- F. Dinelli, P. Pingue, G. Signore, S. Napolitano, *Microscopy*, 280, 280-286 (2020)., DOI: 10.1111/jmi.12954.
- 22. J. M. H. M. Scheutjens, G. J. Fleer, *Journal of Physical Chemistry A.*, **84**, 178-190 (1980).
- 23. X. Li, X. Lu, ACS Macro Letters, **8**, 1426-1431 (2019)., DOI: 10.1021/ acsmacrolett.9b00472.
- 24. M. Sen, N. Jiang, J. Cheung, M. K. Endoh, T. Koga, D. Kawaguchi, K. Tanaka, ACS Macro Letters, 5, 504-508 (2016)., DOI: 10.1021/acsmacrolett.6b00169.
- M. J. Burroughs, S. Napolitano, D. Cangialosi, R. D. Priestley, *Macromolecules*, 49, 4647-4655 (2016)., DOI: 10.1021/acs.macromol.6b00400.
- N. Jiang, M. Sen, W. Zeng, Z. Chen, J. M. Cheung, Y. Morimitu, M. K. Endoh, T. Koga, M. Fukuto, G. Yuan, S. K. Satija, J-M. Y. Carrillo, B. G. Sumpter, *Soft Matter*, 14, 1108-1119 (2018)., DOI: 10.1039/x0xx00000x.
- 27. M. Inutuka, M. Haraguchi, M. Ozawa, N. L. Yamada, K. Tanaka, ACS Macro Letters,
 8, 267-271 (2019)., DOI: 10.1021/acsmacrolett.8b00971.
- 28. T. Koga, P. Gin, H. Yamaguchi, M. K. Endoh, M. Asada, L. Sendogdular, M. Kobayashi, A. Takahara, B. Akgun, S. K. Satija, T. Sumi, *Polymer*, **52**, 4311-4336 (2011)., DOI: 10.1016/j.polymer.2011.07.039.
- C. R-Tinoco, D. N. Simavilla, R. D. Priestley, M. Wübbenhorst, S. Napolitano, ACS Macro Letters, 9, 318-322 (2020)., DOI: 10.1021/acsmacrolett.9b00999.
- N. Jiang, J. Wang, X. Di, J. Cheung, W. Zeng, M. K. Endoh, T. Koga, S. K. Satija, Soft Matter, 12, 1801-1809 (2016)., DOI: 10.1039/c5sm02435h.
- 31. D. A. Barkley, N. Jiang, M. Sen, M. K. Endoh, J. G. Rudick, T. Koga, Y. Zhang, O. Gang, G. Yuan, S. K. Satija, D. Kawaguti, K. Tanaka, A. Karim, *Macromolecules*, 50, 7657-7665 (2017)., DOI: 10.1021/acs.macromol.7b01187.

- 32. N. Jiang, J. M. Cheung, Y. Guo, M. K. Endoh, T. Koga, G. Yuan, S. K. Satija, *Macromolecular Chemistry and Physics*, **219**, 1700326-1700336 (2018)., DOI: 10.1002/macp.201700326.
- M. Asada, N. Jiang, L. Sendogdular, J. Sokolov, M. K. Endoh, T. Koga, M. Fukuto, L. Yang, B. Akgun, M. Dimitriou, S. Satija, *Soft Matter*, 10, 6392-6403 (2014)., DOI: 10.1039/c4sm00683f.
- 34. Y. Morimitu, D. Salatto, N. Jiang, M. Sen, S. Nishituji, B. M. Yavitt, M. K. Endoh, A. Subramanian, C-Y. Nam, R. Li, M. Fukuto, Y. Zhang, L. Wiegart, A. Fluerasu, K. Tanaka, T. Koga, *Macromolecules*, **52**, 5157-5167 (2019)., DOI: 10.1021/acs.macromol.9b00597.

第二章

ポリスチレン(PS)吸着層の作製と評価

2-1 試料

2-1-1 ポリスチレン(PS)

重量平均分子量(*M*_w)が 280 kg/mol の Sigma-Aldrich 社のものを使用した。 以下の式により算出した PS の回転半径(*R*_g)¹⁾は 9.95 nm である。

 $R_g^2 = \frac{1}{6} n b^2 \qquad (2-1)$

ここで n は重合度(n=2692)、b はセグメント長(b=0.47 nm)である。

2-1-2 トルエン

溶液調製およびバルク層の除去には富士フィルム和光純薬工業株式会社の試 薬特級、純度 99.5%のものを用いた。

2-1-3 シリコン基板

直径:100±0.5 mm、厚さ:500±50 μm、結晶軸:100の片面鏡面研磨のもの を使用した。基板は適切なサイズにカットし、実験に用いた。

2-1-4 ピラニア溶液

濃硫酸(H₂SO₄) (98 vol %, ナカライテスク株式会社)と過酸化水素水(H₂O₂) (30 vol %, 富士フィルム和光純薬工業株式会社)を H₂SO₄:H₂O₂=3:1の体積比 で混合したものであり、基板の酸処理・有機物の除去に用いた。

2-1-5 フッ酸溶液

フッ化水素酸水溶液(46 vol%,富士フィルム和光純薬工業株式会社)を超純水で10倍に希釈して用いた。ピラニア酸処理したシリコン基板をフッ酸水溶液 に浸すことで表面の自然酸化層を除去し、疎水性表面を得た。

2-1-6 超純水

本研究では超純水として、水道水を日本ミリポア株式会社の Elix (純水製造装置)・Milli-Q 水 (超純水製造装置) に循環させて得られる水 (比抵抗値は 18.2 MΩ cm) を、フッ酸水溶液の調製および対水接触角測定に用いた。

2-2 装置

2-2-1 スピンコーター(1H-7D, ミカサ株式会社)

基板を試料台に両面テープで固定し、調製した高分子溶液を基板上に滴下し て高速回転させることで溶媒を蒸発させ薄膜を作製する装置として用いた。

2-2-2 真空加熱乾燥機(VOS-601SD, 東京理科器械株式会社)

試料をアニール処理するために用いた。温度は150 ℃で用いた。また、ダイ ヤフラム真空ポンプ(V-100、日本ビュッヒ株式会社)を用いて乾燥機内を真空 にした。

2-2-3 エリプソメーター (ELC-300, 日本分光株式会社)

作製した薄膜の厚みを測定するために用いた。Xe 光源の波長 260~950 nm を 用いて入射角 45.0 ° で行った。

2-2-4 原子間力顕微鏡(AFM5200S,日立ハイテク株式会社)

各試料の表面形状観察に用いた。カンチレバーはシリコン製の SI-DF3(共振 周波数 26 kHz、ばね定数 1.8 N/m、先端径 10 nm)を使用した。モードはカンチ レバーを共振させながら走査するダイナミック・フォース・モード(Dynamic Force Mode; DFM)で行った。

2-2-5 接触角計(DMS-401,協和界面科学株式会社)

各試料の表面自由エネルギーを算出するために用いた。プローブは水とジョ ードメタンを用い、測定条件は滴下量 2.0 µL、気温 25 ℃、相対湿度 35 %で行っ た。

2-3 実験手順

2-3-1 溶液調製

PS/トルエンの溶液を濃度が 3 wt%になるように調製し、25 °C の恒温槽内で 24 h 静置した。

2-3-2 PS 膜の作製

シリコン基板を用途に応じた大きさに切り出し、エタノール中で超音波洗浄 を行った。次に、ピラニア酸に基板を浸し、約90°C で 60 分間酸処理を行った。 ピラニア酸を超純水で十分に洗い流した後、10 倍希釈したフッ化水素酸水溶液 (HF 含有量 4.0%)に1分浸すことで基板表面を疎水化した。上記の処理を終えた 基板に PS 溶液を滴下し、スピンコーターを用いて、回転数 2000 rpm で製膜を 行った。製膜後、真空加熱乾燥機を用いて 150°C で 48 時間の真空アニール処理 を行った。本実験では以上の過程を経て作製した膜を PS 膜と表記する。

2-3-3 PS 吸着層の作製

上述の PS 膜に、パスツールを用いて良 溶媒(トルエン)をかける操作と、試料を 良溶媒に浸漬し 300 rpm 程度で 10 min 攪拌 する操作を交互に 2 回ずつ行い、バルク層 を洗い流した(Figure 2-1)。その後、再度良 溶媒(トルエン)をかけ流し、温度 150 °C、 6 時間の真空アニール処理を再び行った。



Figure 2-1. PS膜のトルエン浸漬.

本実験では以上の過程を経て作製した膜を PS 吸着層と表記する。

2-3-4 膜厚測定

エリプソメーターを用いて試料の膜厚を測定した。スペクトル測定条件は入 射角 45.0 °、バンド幅 1.0 nm、レスポンス 0.5 sec、開始波長 300 nm、終了波長 800 nm、データ取り込み間隔 2 nm、分解能 0.1 nm で測定を行った。

2-3-5 表面形状観察

AFM を用いて試料の表面形状の観察を行った。カンチレバーはシリコン製の SI-DF3(共振周波数 26 kHz、ばね定数 1.8 N/m、先端径 10 nm)を使用し、モー ドはカンチレバーを共振させながら表面を走査する DFM で行った。

2-3-6 各試料の表面自由エネルギーの算出

接触角計を用いて、PS 膜、PS 吸着層の表面自由エネルギーを算出した。測定 条件は滴下量 2.0 μL、気温 25 °C、相対湿度 35 %で行った。表面自由エネルギー は、表面張力と接触角の関係式である Young の式 ²⁾(2-2) (Figure 2-2)と付着仕事 (*W_{SL}*)の関係式である Dupre の式 ³⁾(2-3) (Figure 2-3)を用いて以下のように求めら れる。

Young の式: $Y_S = Y_{SL} + Y_L \cos\theta$ (2-2)Dupre の式: $Y_S + Y_L = W_{SL} + Y_{SL}$ (2-3)

(2-2)式と(2-3)式より

Young-Dupre \mathcal{O} 式: $W_{SL} = Y_L (1 + \cos\theta)$ (2-4)

が求められる⁴⁾。ここで、 Y_S は固体の表面自由エネルギー、 Y_L は液体の表面張力、 Y_{SL} は固体と液体の界面張力である。



Figure 2-2. 固体表面上の液滴における力のつり合い.



Figure 2-3. 付着仕事のつり合い.

接触角計による表面自由エネルギーの算出にあたり、Owens Wendt の理論 5を用いることで、表面張力が分散成分(γ^d)と水素結合成分(γ^h)に分けることができる。 (2-5)

$$Y^{total} = Y^d + Y^h$$
 (2-5)
(2-3)式に(2-5)式を当てはめると、
 $W_{SL} = 2\sqrt{Y_S^d Y_L^d} + 2\sqrt{Y_S^h Y_L^h}$ (2-6)
と変換できる。

ここで、(2-4)式と(2-6)式より

$$\sqrt{Y_S^d Y_L^d} + \sqrt{Y_S^h Y_L^h} = \frac{Y_L^{total}(1+\cos\theta)}{2}$$
 (2-7)

が求められる。

(2-5)式と(2-7)式を用いて固体の表面自由エネルギーを算出するために、 γ^{d} および γ^{h} が既知の液体を使って、固体の接触角を測定する。本研究では、水とジョードメタンを使用した。水とジョードメタンの γ^{d} および γ^{h} の文献値を Table 2-1 に示す ⁵。

Table 2-1. 水とジョードメタンの表面張力.⁵⁾

液体	$\gamma^d \; [mJ/m^2]$	$\gamma^h \; [mJ/m^2]$	$\gamma^{total} \ [mJ/m^2]$
H ₂ O	21.8	51.0	72.8
CH_2I_2	49.5	1.3	50.8

2-4 結果と考察

2-4-1 PS 膜および PS 吸着層の膜厚

エリプソメーターを用いて求めた PS 膜および PS 吸着層の膜厚を Table 2-2 に 示した。

Table 2-2. PS 膜および PS 吸着層の膜厚.

厚み [nm]			
PS膜	PS吸着層		
169±0.9	10.3 ± 0.1		

Table 2-2 より、PS 吸着層は PS 膜に比べてとても薄い膜であることがわかる。 また、本実験で使用した PS の R_g は 9.95 nm であり、吸着鎖の膜厚は使用した高 分子の R_g と近い値になることが示された。

2-4-2 PS 膜および PS 吸着層の表面形状の観察



Figure 2-4. PS 膜の表面形状像(走査範囲: (a) 20 μm×20 μm、(b) 5 μm×5 μm、(c) 1 μm×1 μm).



Figure 2-5. PS 吸着層の表面形状像 (走査範囲: (a) 20 μm×20 μm、(b) 5 μm×5 μm、(c) 1 μm×1 μm).

AFM を用いて観察した PS 膜および PS 吸着層の表面形状像を Figure 2-4 および Figure 2-5 に示した。走査範囲は、20 µm×20 µm、5 µm×5 µm、1 µm×1 µm で ある。これらの結果より、PS 膜および PS 吸着層はいずれも Si 基板が露出して いない連続したポリスチレンの層を形成していることが確認された。また、AFM を用いて観察した表面形状像より、PS 膜および PS 吸着層の表面の二乗平均平 方根粗さ(RMS)を評価し、Table 2-3 にまとめた。

Table 2-3. PS 膜および PS 吸着層の RMS 値.

試料	RMS [nm]
PS膜	0.37 ± 0.01
PS吸着層	0.27 ± 0.02

Table 2-3 より、PS 膜よりも PS 吸着層の表面は平滑であることがわかる。これは、PS 吸着層は基板界面に束縛されているため、熱アニール処理による分子 鎖運動の影響が PS 膜に比べて小さいためと考える。 2-4-3 PS 膜および PS 吸着層の表面自由エネルギーの算出

表面自由エネルギーを求めるために行った、液体プローブとして水とジョード メタンを用いた接触角測定の結果を Figure 2-6 にまとめた。なお、接触角測定で は、いずれの試料においても 5 点以上で測定を行い、平均することで結果を得 た。



Figure 2-6. 各試料における接触角測定結果: PS 膜(液体プローブ(a)水、(b)ジヨ ードメタン)、PS 吸着層(液体プローブ(c)水、(d)ジヨードメタン).

試料	表面自由エネルギー [mJ/m ²]
PS膜	45.0
PS吸着層	45.1

Table 2-4. PS 膜および PS 吸着層の表面自由エネルギー.

2-3-6 に記述した算出方法を用いて PS 膜および PS 吸着層の表面自由エネルギーを算出し、Table 2-4 にまとめた。この結果より、PS 膜および PS 吸着層の表面自由エネルギーに殆ど違いはないと確認された。

2-5 まとめ

この章では、PS 膜を T_g以上の温度で熱処理することで Si 基板界面に界面近 傍の分子鎖が物理吸着し、トルエンで浸漬することで作製された PS 吸着層の評 価を行った。エリプソメトリーにより求めた膜厚から、PS 吸着層の厚みは PS 膜 に比べて薄く、R_gに近い値をとることが示唆された。また、AFM を用いた表面 形状観察により、PS 吸着層は Si 基板が露出していない連続したポリスチレンの 層であることに加え、表面粗さが PS 膜に比べて小さい平滑な層であることが確 認された。また、接触角計を用いて表面自由エネルギーの算出を行った結果、PS 膜と PS 吸着層の表面自由エネルギーに顕著な違いはないことが確認された。

2-6 参考文献

- J. Xavier, S. Sharma, Y. Seo, R. Isseroff, T. Koga, H. White, A. Ulman, K. Shin, S. K. Satijia, J. Sokolov, M. H. Rafailovich, *Macromolecules*, **39**, 2972-2980 (2006)., DOI: 10.1021/ma050454m.
- T. Young, *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, **95**, 65-87 (1805)., DOI: 10.1098/rstl.1805.0005.
- 3. 中前 勝彦, 水町 浩, 浦濱 圭彬, 接着の化学と応用, 日本化学会 (1998)., ISBN: 4477008880.
- 4. Y. Akamatsu, New Glass, 21, 27-34 (2006).
- D. K. Owens, R. C. Wendt, Journal of Applied Polymer Science, 13, 1741-1747 (1969)., DOI: 10.1002/app.1969.070130815.

第三章

PS 吸着層上における

感圧接着テープ(PSA)テープ剥離強度の評価

3-1 緒言

PSA テープを用いた剥離試験には、90 度剥離試験、180 度剥離試験、T 型剥離 試験といった用途に応じた様々な測定方法がある^{1,2)}(Figure 3-1)。その中でも、 180 度剥離試験は、PSA テープのたるみによる試験結果への影響が少ないという 点から、工業的に広く用いられている剥離試験方法である³⁾。本研究では、180 度剥離試験を採用し、PS 膜および PS 吸着層上における PSA テープ剥離強度を 測定した。また、180 度剥離試験は JIS 規格 Z0237:2009 に一部準拠して行った。



Figure 3-1. PSA テープを用いた剥離試験例.

3-2 試料

3-2-1 被着体

被着体には、第二章で作製した PS 膜および PS 吸着層を用いた。リファレンス試料として Si 基板を用いた。

3-2-2 感圧接着(PSA)テープ

スコッチ超透明テープS(3Mジャパン株式会社)のテープ幅12mm、テープ 厚0.045mmのものを180度剥離試験で用いた。本研究では専用テープカッター (Figure 3-2)でテープ幅を6mmにして使用した。



Figure 3-2. 専用テープカッターの写真.

3-3 装置

3-3-1 荷重変動型摩擦摩耗試験システム(HHS2000,新東科学株式会社)

180 度剥離試験において剥離強度を計測するために用いた。モードは一定荷重 摩擦測定を選択し、圧子の代わりに底面積 16 mm×24 mm の専用ステレンス治具 を用いた。測定条件は移動距離 50 mm、剥離速度 300 mm/min、一定荷重 1 g で 行った。



Figure 3-3. 荷重変動型摩擦摩耗試験システムの写真.

3-3-2 力学試験機

180 度剥離試験において、剥離強度を計測するために用いた。フォースゲージ (ZTA-50N, イマダ株式会社)を電動計測スタンド(EMX シリーズ, イマダ株式 会社)に取り付け使用した。測定条件は、剥離速度 300 mm/min で行った。使用 治具は、上部:フィルムチャック(FC-21, イマダ株式会社)、下部:挟み込み治 具(GTW-50R, イマダ株式会社)を使用した。



Figure 3-4. 力学試験機の写真.

三重大学大学院 工学研究科 23

3-4 実験手順

3-4-1 PSA テープの貼付方法

PSA テープの貼付荷重を制御するために分銅を用いた。分銅は 100g および 1 kg のものを用い、PSA テープにかかる圧力を均一にするために分銅の下に制圧 板としてアクリル板を敷いた。PSA テープを貼付する際はテープとアクリル板 の間にクリーンワイプをはさみ、クリーンワイプを手動で動かした。模式図を Figure 3-5 として下に示した。アクリル板を用いた際の PSA テープに対する圧力 面積は 0.6 cm² であり、印加される圧力は分銅 100g の際は 1.7 kPa、分銅 1 kg の 際は 16.7 kPa であった。なお、感圧接着テープ貼付直後に剥離する際は 5 分以 内に剥離した。荷重は感圧接着テープを貼付時のみ印加し、その後剥離するまで は荷重をかけることなく、室温(25 ℃)で静置した。



Figure 3-5. PSA テープの貼付方法のイメージ図.

3-4-2 荷重変動型摩擦摩耗試験システムを用いた 180 度剥離試験

Figure 3-6 に荷重変動型摩擦摩耗試験システムを用いた 180 度剥離試験の模式 図を示す。荷重変動型摩擦摩耗試験システムに専用測定子を用いることで PS 膜 表面におけるテープ剥離強度を計測した。また、専用測定子の詳細を Figure 3-7 に示す。PSA テープを貼付する試料サイズは、30 mm×30 mm であった。







Figure 3-7. 専用測定子の設計図.

3-4-3 力学試験機を用いた 180 度剥離試験

Figure 3-8 に、力学試験機を用いた 180 度剥離試験の模式図を示す。フォース ゲージを電動計測スタンドに取り付け、180 度剥離試験を行った。PSA テープを 貼付する試料サイズを、2 cm×9 cm にすることで、一枚の試料から連続的な測定 を可能とした。これにより、製膜による試料ごとの誤差を減らし、剥離強度のテ ープ貼付時間依存性を評価した。長方形の試料は、PS 膜および PS 吸着層を製 膜後に切り出すことで作製した。



Figure 3-8. 力学試験機を用いた 180 度剥離試験の模式図.

3-5 結果と考察



3-5-1 荷重変動型摩擦摩耗試験システムを用いた 180 度剥離試験の結果

Figure 3-9. 貼付荷重 100gにおける剥離強度の経時変化.



Figure 3-10. 貼付荷重 1 kg における剥離強度の経時変化.

荷重変動型摩擦摩耗試験システムを用いた 180 度剥離試験による、PS 膜、PS 吸着層および Si 基板における剥離強度の PSA テープ貼付時間依存性を Figure 3-9 および Figure 3-10 に貼付荷重別にそれぞれ示した。

Figure 3-10 より、貼付時間が 24 h 以降において PS 吸着層>PS 膜>Si 基板の 順に剥離強度が大きいことがわかる。これは、Si 基板の 2h 以降の剥離強度の変 化が大きくないことから、PS 分子鎖の有無が影響していると考えられる。いず れの試料においても、貼付直後から 2h 後にかけて剥離強度が増減し、それ以降 は大きくなる傾向が確認された。これは Si 基板上においても確認されたため、 粘着剤由来の効果だと考えられる。貼付時に印加された荷重により変形した粘 着剤は、その弾性反発によりひずみが緩和することで剥離強度が減少する。その 後、緩和した粘着剤の濡れが進行し剥離強度が増加したと考えられる。しかし、 荷重変動型摩擦摩耗試験システムを用いた 180 度剥離試験では剥離距離が 2.5 cm と短く、測定時間ごとに別のサンプルを使用しているため、測定誤差の影響 も大きい可能性が考えられた。

そこで、これらの仮説を明らかにするために、同じサンプルから連続的に測定 が可能にするため、剥離距離が 90 mm の大きさの試料を作製し、再度 180 度剥 離試験を実施した。

3-5-2 力学試験機を用いた 180 度剥離試験の結果



Figure 3-11. 貼付荷重 100gにおける剥離強度の経時変化.



Figure 3-12. 貼付荷重 1kg における剥離強度の経時変化.

三重大学大学院 工学研究科 29 力学試験機を用いた 180 度剥離試験による、PS 膜、PS 吸着層および Si 基板 における剥離強度の PSA テープ貼付時間依存性を Figure 3-11 および Figure 3-12 に貼付荷重別にそれぞれ示した。いずれの試料においても Figure 3-9 および Figure 3-10 でも示された、貼付直後から 2h にかけての剥離強度の増減が確認さ れた。特に増減幅が大きい Si 基板に注目すると、貼付荷重を重くすることで剥 離強度のピーク時間が左にシフトしていることがわかる。これは粘着剤に印加 された力が強いほど粘着剤の濡れの進行が早くなるためと考えられる。しかし、 粘着剤の弾性力が影響しているという仮説を本研究では明らかに出来なかった ため、今後の課題であると考える。



Figure 3-13. 各試料上における剥離強度の貼付荷重依存性(貼付時間 5 min).

Figure 3-13 は、Figure 3-11 および Figure 3-12 における貼付時間 5 min の各試 料の剥離強度を貼付荷重別に比較した結果である。この結果より、貼付時間 5 min において剥離強度は Si 基板、PS 吸着鎖、PS 膜の順で大きいことが確認され た。また、剥離強度の大小の差が 100 g よりも 1 kg の方が大きいことが確認さ れた。

粘着剤の濡れ性は剥離強度に対して、大いに影響を与えると考えられるため、 この結果を、表面自由エネルギーと試料の表面形状の観点から考察を行った。 2-4-3 において、PS 膜と PS 吸着層の表面自由エネルギーを算出しているため、 ここでは PSA テープと Si 基板の表面自由エネルギーを算出し Table 3-1 にまと めた。PSA テープおよび Si 基板における、液体プローブとして水とジョードメ タンを用いた接触角測定の結果を Figure 3-14 にまとめた。なお、接触角測定は、 いずれの試料においても 5 点以上で測定を行い、平均することで結果を得た。



Figure 3-14. 各試料における接触角測定結果: PSA テープ(液体プローブ(a)水、(b)ジヨードメタン)、Si 基板(液体プローブ(c)水、(d)ジヨードメタン).

試料	表面自由エネルギー [mJ/m ²]
PSAテープ	32.3
Si基板	41.1
PS膜	45.0
PS吸着層	45.1

Table 3-1. 各試料の表面自由エネルギー.

表面自由エネルギーの値の差が小さいほど試料間の親和性が高い、つまり界 面濡れ性が良いことを示しており、接着の分野では濡れ性が大きいほど接着力 が高くなることが知られている^{4,5)}。Table 3-1 より、PSA テープの表面自由エネ ルギーの値との差が一番小さい試料は Si 基板であることが確認された。この結 果より、Si 基板は PS 膜および PS 吸着層よりも貼付直後の濡れの進行が早く、 粘着剤との接着面積が増加したため、剥離強度が大きくなったと考えられる。ま た、PS 膜と PS 吸着層の剥離強度の差は、表面粗さの違いを反映していると考 えられる。前章の Table 2-3 より、PS 膜よりも PS 吸着層の方が、表面が平滑であることが確認されている。この結果より、PS 吸着層の方が貼付直後の粘着剤との接着面積が大きいことがわかる。この PS 膜と PS 吸着層の粘着剤との接着面積の違いが剥離強度の差に顕れたと考える(Figure 3-15)。



Figure 3-15. 表面形状と濡れ性の相関イメージ.

また、Figure 3-13 に示された、剥離強度の差が 100 g よりも 1 kg の方が大き いという結果は、上記で考察した表面自由エネルギーと表面形状が与える接着 面積への影響を強い力で印加することで促進したためと考えられる。



Figure 3-16. 各貼付時間における剥離強度(貼付荷重1kg).

Figure 3-16 は、貼付荷重1 kg における剥離強度の貼付時間依存性をまとめた グラフである。この結果より、PS 膜と PS 吸着鎖の剥離強度は、貼付時間が長く なることで増加したことが確認された。この結果は、テープ貼付後から時間が経 過することで、PS の高分子鎖と粘着剤の高分子鎖の絡み合いが起き、初期接着 に比べ剥離強度の増加に影響を与えたと考えられる。また、PS 膜よりも PS 吸 着層の剥離強度が大きい結果は、PS 膜と PS 吸着層における分子鎖凝集状態の 違いを反映していると考えられる。PS 吸着層の分子鎖は PS 膜表面の分子鎖と 比較して基板に強く束縛されているため、絡み合った粘着剤分子鎖を引き抜く 際にも大きな力が必要になると考えられる(Figure 3-17)。しかし、貼付荷重 100 g の条件における剥離強度の経時変化を示した Figure 3-11 において、PS 膜および PS 吸着層の貼付時間 2 h 以降の剥離強度の増加傾向は確認されなかった。貼付 荷重の違いは初期接着に強く影響するため、貼付荷重 100 g の条件であっても、 長い貼付時間によって粘着剤の濡れが進行し、分子鎖の絡み合いが発生すると 考えられる。Figure 3-9 においては、PS 膜および PS 吸着層の貼付時間 2 h 以降 の剥離強度の増加傾向が確認されていたため、今後、測定回数を重ね、再検討す る必要があると考える。



Figure 3-17. PS 膜および PS 吸着層と粘着剤界面の時間依存性の仮説.

3-6 まとめ

180 度剥離試験により、PS 膜上および PS 吸着層上における PSA テープ剥離 強度の経時変化を評価した。貼付時間 5 min において剥離強度は Si 基板、PS 吸 着鎖、PS 膜の順で大きいことが確認された。また、貼付時間 5 min における剥 離強度の差が 100 g よりも 1 kg の方が大きいことが確認された。初期接着にお いて剥離強度が Si 基板>PS 吸着層>PS 膜の順で大きいという結果は、各試料 における表面自由エネルギーと表面形状による粘着剤との接着面積の違いが影 響しており、貼付荷重を重くすることでその影響を促進させると考えられた。

また、PS 膜上および PS 吸着鎖上における剥離強度は、貼付時間が長くなる ことで増加していることが確認された。この結果は、Si 基板からは確認されな いことから、テープ貼付後から時間が経過することで、PS 分子鎖と粘着剤分子 鎖の絡まり合いが起き、剥離強度の増加に影響を与えたと考えられる。また、PS 膜上よりも PS 吸着層上の剥離強度が大きい結果は、PS 膜と PS 吸着層における 分子鎖凝集状態の違いを反映していると考えられる。PS 吸着層の分子鎖は PS 膜 表面の分子鎖と比較して基板に強く束縛されているため、絡み合った粘着剤分 子鎖を引き抜く際にも大きな力が必要になると考えられる。

3-7 参考文献

- K. H. Tsai, K. S. Kim, International Journal of Solids and Structures, 30, 1789-1806 (1993)., DOI: 10.1016/0020-7683(93)90234-X.
- K. Maeda, Japanese Journal of Polymer Science and Technology, 4, 216-222 (1955)., DOI: 10.1295/kobunshi.4.216.
- 3. Y. Inao, N. Saeki, T. Sugisaki, M. Shimizu, K. Inaba, K. Kishimoto, *Journal of the Adhesion Society of Japan*, **48**, 308-313 (2012)., DOI: 10.11618/adhesion.48.308.
- 4. Y. Urahama, Journal of the Adhesion Society of Japan, **31**, 47-58 (1989)., DOI: 10.4139/sfj.40.1179.
- K. Sugita, Journal of Printing Science and Technology, 35, 202-210 (1998)., DOI: 10.11413/nig1987.35.202.
第四章

中性子反射率測定(NR)測定を用いた PS/粘着剤界面

における界面構造の解析

4-1 緒言

異種高分子材料界面において、分子鎖の緩和および拡散による界面層を評価 することは非常に重要である。また、埋もれた界面構造解析として中性子反射率 (Neutron Reflectivity; NR)測定はとても有効である。NR 測定において、水素原子 と重水素化原子は、本質的に化学的に同一であるにもかかわらず、中性子散乱長 密度(Scattering Length Density; SLD)が大きく異なる。この性質を活かすことで、 高分子の化学的性質を大きく変更することなく、重水素化によってラベリング することが可能である。また、中性子は透過率が高いため、非破壊で埋もれた界 面の構造を解析することが可能である。そのため、NR 測定は異種材料の界面形 成を確認するために広く用いられている^{1,2)}。本研究では、重水素化ポリスチレ ン(d-PS)と粘着剤主成分であるポリアクリル酸ブチル(Poly butyl acrylate; PBA)を 用いることで、d-PS/粘着剤(PBA)接着界面の界面構造の観察を行った。

4-2 試料

4-2-1 重水素化ポリスチレン(d-PS)

 M_w が 110 kg/mol、多分散度 (M_w/M_n) が 1.06 の Polymer Source 社のものを使用 した。ポリスチレンの軽水素(H)が全て重水素(D)に置換されている d-8 体であり、 NR 測定での軽水素と重水素とのラベリングのために使用した。d-PS の回転半径 (R_g) は式(4-1)より 6.01 nm であった。

 $R_g^2 = \frac{1}{6}nb^2 \qquad (4-1)$

ここで n は重合度(n=982)、b はセグメント長(b=0.47 nm)である。

4-2-2 ポリアクリル酸ブチル(PBA)溶液

*M*_wが 99 kg/mol (by GPC in Toluene)の Sigma-Aldrich 社のものを使用した。NR 測定の粘着剤主成分として用いた。また、NR 測定で用いる際はトルエンを完全 に揮発させてから用いた。

4-2-3 シリコン基板

縦横の長さ40mm、厚さ7mmのものを実験に使用した。

4-3 装置

4-3-1 中性子反射率計

d-PS と PBA(粘着剤主成分)の界面構造を解析するために NR を利用した。 NR 測定には茨城県東海村の大強度陽子加速器施設(J-PARC)物質・生命科学実 験施設(MLF) BL16 のソフト界面解析装置(SOFIA)を用いた^{3,4)}。NR 測定では陽 子ビームを 25 Hz で水銀ターゲットに照射し、原子核が粉砕された際に飛び出 す白色中性子(パルス中性子ビーム)を用いている。白色中性子の波長領域は 0.2~0.88 nm を用いており、飛行時間(Time-of-Flight; ToF)法によりそれぞれの中 性子の波長を求めることができる。これにより入射角を変更せずに一定のq範囲 の測定が可能である。中性子反射率測定では、試料からの反射プロファイルをダ イレクトビームのプロファイルで割ることで反射率を求めることができる。ToF は、次の式から中性子源と検出器間の距離L'(17.9 m)を使用して波長λに変換さ れる。

$\lambda [nm] = 3.956 \times 10^{-6} [m^2/s] \times t [ms]/L' [m] \quad (4-2)$

変換された波長および反射率から、以下の試料深さ方向の中性子の移行運動量q の関数として反射率プロファイルを得る。反射率のデータは縦軸が反射率、横軸 は移行運動量qで表される。qは、入射角θおよび波長λに依存し、次の式で表さ れる。

$q = 4\pi sin\theta/\lambda$ (4-3)

中性子ビームの入射角は、0.3°、0.75°、1.8°で行い、データを結合させることで、反射率曲線を広いq範囲でカバーした。

測定により得られた反射率曲線を解析ソフトウェアである motofit³⁾を用いて モデル解析することで SLD プロファイルを得ることができる。そのプロファイ ル中の SLD の分布から d-PS/PBA の膜厚方向の構造解析を行った。Figure 4-1 に 典型的な SLD プロファイルの一例を示した。



SLD は以下の式を用いて計算できる。

$$SLD = \frac{(\sum b_i)dN_A}{M} \tag{4-4}$$

ここで、 b_i は核種 i の散乱長、dは物質の密度、Mは分子量(高分子であれば繰り返し単位当たり)、 N_A はアボガドロ数(6.02×10^{23} /mol)を示している。 Table 4-1 に各物質の SLD を示す。

Materials	Σb_i [fm]	<i>d</i> [g/cm ³]	M [g/mol]	SLD [10 ⁻⁴ nm ⁻²]
d-PS	106.536	1.12	112	6.41
PBA	20.738	1.087	126	1.07
Si	4.1491	2.33	28	2.07
Air	N/A	N/A	N/A	0

Table 4-1. 各物質の散乱長密度.

4-4 実験手順

4-4-1 溶液調製

(d-PS/トルエン)の溶液を濃度が2wt%になるように調製し、恒温槽(25℃)内で24h静置した。

4-4-2 d-PS 膜および d-PS 吸着層の作製

2-3-2、2-3-3 で記述した PS 膜および PS 吸着層の作製手順と同様の手順で行った。

4-4-3 膜厚測定

エリプソメーターを用いて試料の膜厚を測定した。

4-4-4 PBA 溶液の溶媒除去

150 ℃ のホットプレート上で PBA 溶液の溶媒であるトルエンを 27 日間揮発 させ、その後、150 ℃で 8h 真空乾燥を行うことで、トルエンを完全に除去した。

4-4-5 d-PS 膜および d-PS 吸着層上への PBA の塗布と NR 測定用セルへのセット

大気中 40 °C の環境下において PBA を d-PS 膜および d-PS 吸着層上に塗布し た。PBA は室温(25 °C)でゴム状態のため、膜上に厚さ 3 mm のシリコンゴムで 囲いを作り、そこへ塗布した(Figure 4-2)。その後、ガラス製のセルで蓋をし、ア ルミ製の自作セルで PBA が漏れない様に固定をした(Figure 4-3)。なお、d-PS 膜 に PBA を塗布した試料を d-PS 膜/PBA、d-PS 吸着層に PBA を塗布した試料を d-PS 吸着層/PBA と表記する。



Figure 4-2. d-PS 膜および d-PS 吸着層上への PBA の塗布のイメージ図.



Figure 4-3. NR 測定用試料のアルミ製自作セルへのセット.

4-4-6 NR 測定

d-PS と PBA(粘着剤)の界面構造を解析するために NR 測定を利用した。測 定は PBA を塗布した後、約 72 h 後に行った。PS 膜および PS 吸着層を測定する 際は膜表面から中性子ビームを入射させた。一方、PBA を塗布後自作セルにセ ットした試料を測定する際は Si 基板から中性子ビームを入射させた(Figure 4-4)。 中性子ビームの入射角[θ]は、0.3°、0.75°、1.8°で行った。



Figure 4-4. 特注セルを使用した NR 測定方法の模式図.

4-4-7 表面自由エネルギーの算出

接触角計を用いて、d-PS 膜、d-PS 吸着層、PBA の表面自由エネルギーを算出 した。試薬は水とジョードメタンを用い、測定条件は滴下量 2.0 μL、気温 25 ℃、 相対湿度 35 %で行った。d-PS 膜および d-PS 吸着層と PBA の表面自由エネルギ ーを比較することで、d-PS と PBA の界面親和性を評価した。

4-5 結果と考察

4-5-1 エリプソメーターを用いた d-PS 膜および d-PS 吸着層の膜厚

エリプソメーターを用いて求めた d-PS 膜および d-PS 吸着層の膜厚を Table 4-2 に示した。

Table 4-2. d-PS 膜および d-PS 吸着層の膜厚.

膜厚 [nm]			
d-PS膜 d-PS吸着層			
71.7	6.65		

本実験で使用した d-PS の R_g は 6.01 nm であることから、2-4-1 の結果と同様 に吸着層の厚みは使用した高分子の R_g に近い値になることが示唆された。

4-5-2 NR 測定

d-PS 膜の NR 測定によって得られた反射率曲線を Figure 4-5 に、SLD プロフ ァイルを Figure 4-6 に示した。



Figure 4-5. d-PS 膜の反射率曲線.



Figure 4-6. d-PS 膜の SLD プロファイル.

三重大学大学院 工学研究科 43 **4-4-5**の手順で d-PS 膜に PBA を塗布した試料の NR 測定によって得られた反 射率曲線を Figure 4-7 に、SLD プロファイルを Figure 4-8 に示した。



Figure 4-8. d-PS 膜/PBA の SLD プロファイル.

d-PS/PBA 界面に d-PS と PBA の混合層が存在すると仮定した結果、実測値に フィッティング線が一致する信頼性の高い SLD モデルを作成することができた。 また、フィッティングの精度を示す χ^2 は、d-PS 膜: 14.983、d-PS 膜/PBA: 16.6124 であった。 χ^2 は値が小さいほどフィッティングの精度が高いことを示している。

次に、Figure 4-5 から Figure 4-8 に示した d-PS 膜と d-PS 膜/PBA の反射率曲線 および SLD プロファイルを Figure 4-9 および Figure 4-10 にそれぞれ示した。



Figure 4-9. d-PS 膜および d-PS 膜/PBA の反射率曲線.



Figure 4-10. d-PS 膜および d-PS 膜/PBA の SLD プロファイル.

PS 膜および PS 膜/PBA の反射率曲線のフィッティングに用いた各パラメー ターの値を Table 4-3 および Table 4-4 に、膜厚方向の構造モデルを Figure 4-11 に示した。

Table 4-3. PS 膜の反射率曲線のフィッティングに用いた各パラメーター値.

bkg: 1.0×10 ⁻⁷	thickness [nm]	SLD [10 ⁻⁴ nm ⁻²]	roughness [nm]
air		0	
d-PS	72.398	6.41	0.5
Si		2.07	0.1

Table 4-4. PS 膜/PBA の反射率曲線のフィッティングに用いた各パラメーター値.

bkg: 1.0×10 ⁻⁷	thickness [nm]	SLD [10 ⁻⁴ nm ⁻²]	roughness [nm]
PBA		1.07	
d-PS/PBA	10	1.3913	4.142
d-PS	72	6.41	2
Si		2.07	0.1



Figure 4-11. 膜厚方向の構造モデル ((a) PS 膜、(b) PS 膜/PBA).

4-4-2 の手順で作製した d-PS 吸着層の、NR 測定によって得られた反射率曲 線を Figure 4-12 に、SLD プロファイルを Figure 4-13 にした。



Figure 4-12. d-PS 吸着層の反射率曲線.



Figure 4-13. d-PS 吸着層の SLD プロファイル.

三重大学大学院 工学研究科 47

4-4-5 の手順で d-PS 吸着層に PBA を塗布した試料の NR 測定によって得られ た反射率曲線を Figure 4-14 に、SLD プロファイルを Figure 4-15 に示した。



Figure 4-14. d-PS 吸着層/PBA の反射率曲線.



Figure 4-15. d-PS 吸着層/PBA の SLD プロファイル.

三重大学大学院 工学研究科 48

d-PS 膜/PBA の場合と同様に、**d-PS**/PBA 界面に **d-PS** と PBA の混合層がある と仮定した結果、実測値にフィッティング線が一致する信頼性の高い SLD モデ ルを作成することができた。また、フィッティングの精度を示す、χ²は **d-PS** 吸 着層: 16.5916、**d-PS** 吸着層/PBA: 3.97267 であった。χ²は、値が小さいほどフ ィッティングの精度が高いことを示している。 次に、Figure 4-12 から Figure 4-15 に示した d-PS 吸着層と d-PS 吸着層/PBA の 反射率曲線および SLD プロファイルを Figure 4-16 および Figure 4-17 それぞれ示 した。



Figure 4-16. d-PS 吸着層および d-PS 吸着層/PBA の反射率曲線.



Figure 4-17. d-PS 吸着層および d-PS 吸着層/PBA の SLD プロファイル.

PS 吸着層および **PS** 吸着層/**PBA** の反射率曲線のフィッティングに用いた各 パラメーターの値を Table 4-5 および Table 4-6 に、膜厚方向の構造モデルを Figure 4-18 に示した。

Table 4-5. PS 吸着層の反射率曲線のフィッティングに用いた各パラメーター値.

bkg: 2.8 × 10 ⁻⁷	thickness [nm]	SLD [10 ⁻⁴ nm ⁻²]	roughness [nm]
air		0	
d-PS	4.3003	6.41	90.9948
Si		2.07	0.1

Table 4-6. PS 吸着層/PBA の反射率曲線のフィッティングに用いた各パラメータ 一値.

bkg: 1.0 × 10 ⁻⁶	thickness [nm]	SLD [10 ⁻⁴ nm ⁻²]	roughness [nm]
PBA		1.07	
d-PS/PBA	1.0	1.08	0.5
d-PS/PBA	2.5	1.2	0.1
d-PS/PBA	5.3	5.2	1.9
d-PS	1.1	6.41	0.2
Si		2.07	0.1



次に、PBA を塗布したことによる d-PS 膜および d-PS 吸着層の界面の広がり を確認するために Figure 4-10 および Figure 4-17 を d-PS の占める体積分率(ϕ_{d-PS}) で規格化をおこなった。体積分率(ϕ_{d-PS})は式 4-5 を用いて算出した。



Figure 4-20. d-PS 吸着層および d-PS 吸着層/PBA の体積分率プロファイル.

Figure 4-19 および Figure 4-20 より、d-PS 膜/PBA および d-PS 吸着層/PBA いず れの体積分率プロファイルにおいても、d-PS と PBA と接触することで界面が広 がり、非対称な d-PS/PBA 界面を形成することが確認された。PS と PBA は室温 (25°C)で非相溶の関係である^{6,7,8)}と知られているが、本研究においては非対称な 界面相を形成した。非相溶の関係であるにもかかわらず、NR 測定により界面相 が確認された結果を、PS および PBA における表面自由エネルギー、ハンセン溶 解度パラメーター (HSP)⁹、ガラス転移温度(*T*g)の観点から考察を行った。表面 自由エネルギーを求めるために行った、液体プローブとして水とジョードメタ ンを用いた接触角測定の結果を Figure 4-21 にまとめた。なお、接触角測定は、 いずれの試料においても 5 点以上で測定を行い、平均することで結果を得た。



Figure 4-21. 各試料における接触角測定結果: d-PS 膜(液体プローブ(a)水、(b) ジヨードメタン)、d-PS 吸着層(液体プローブ(c)水、(d)ジヨードメタン)、PBA (液体プローブ(e)水、(f)ジヨードメタン).

武料	表面自由エネルギー [mJ/m ²]
d-PS膜	46.8
d-PS吸着層	44.9
PBA	45.8

Table 4-7. 各試料における表面自由エネルギー.

Table 4-8. 各試料の Tg および HSP 値⁹.

試料	$T_{\rm g}$ [°C]	HSP値 [(MPa) ^{1/2}]
d-PS	100	18.72
PBA	-55	18.52

Table 4-7 より、d-PS 膜および d-PS 吸着層と PBA の表面エネルギーに顕著な 違いは確認されなかった。このことから、界面における親和性は高いと考えられ る。さらに、Table 4-8 に示される HSP の値が近いことからも試料間の親和性が 高いと考えられる。また、PS は室温(25 °C)でガラス状態(T_g =100 °C)であるが、 PBA は室温でゴム状態(T_g =-55 °C)である。異種高分子界面においてガラス/ゴム 界面ではゴム状物質の低い T_g がガラス状物質の T_g を低下させるとの研究例が報 告されている¹⁰⁾。よって本研究においても、界面 T_g の低下に伴う分子鎖相互拡 散により界面相を形成し、その際に d-PS(ガラス状)と PBA(ゴム状)の分子 運動性の違いにより非対称界面が形成されたと考えられる^{11,12)}。また、ガラス/ ゴム界面における非対称界面の形成は他の研究においても確認されている¹³⁾た めこの結果の信頼性は高いと考えられる。 次に d-PS 膜/PBA と d-PS 吸着層/PBA の界面構造を比較するために、NR 測定 により得られたそれぞれの SLD プロファイルを Figure 4-22 にまとめた。



Figure 4-22. d-PS 膜/PBA および d-PS 吸着層/PBA の SLD プロファイル. (斜線部: d-PS 膜/PBA および d-PS 吸着層/PBA の界面相)

Figure 4-22 より算出した、d-PS 膜/PBA および d-PS 吸着層/PBA の界面幅を Table 4-9 に、界面の体積分率を Table 4-10 にまとめた。界面幅は、d-PS 膜/PBA および d-PS 吸着層/PBA の SLD プロファイルにおいて、SLD 値が 6.41 (d-PS の SLD 値) から 1.07 (PBA の SLD 値) まで変化している範囲とした。また、体積 分率は、式 4-6 および式 4-7 を用いて算出した。

 $\frac{SLD_{interface} - SLD_{PBA}}{SLD_{dPS} - SLD_{PBA}} = \Phi_{dPS} \quad (4-6)$

 $1 - \Phi_{dPS} = \Phi_{PBA} \quad (4-7)$

 界面幅 [nm]

 d-PS膜/PBA
 35.72

 d-PS吸着層/PBA
 12.07

Table 4-9. d-PS 膜/PBA および d-PS 吸着層/PBA の界面幅.

Table 4-10. d-PS 膜/PBA および d-PS 吸着層/PBA の界面体積分率.

界面の体積分率	d-PS膜/PBA	d-PS吸着層/PBA
$arPsi_{ m dPS}$	27.3 %	40.5 %
$arPhi_{ m PBA}$	72.7 %	59.5 %

Table 4-9 より、d-PS 吸着層/PBA の界面厚は d-PS 膜/PBA 界面厚よりも3分の 1程度であると確認された。また、Table 4-10 より、界面における PS の体積分 率が PS 膜の界面より大きいことから、d-PS 吸着層には PBA 分子鎖が拡散しに くいことがわかる。この結果は、d-PS 吸着層は基板界面に多点吸着しているた め界面 T_gが高く^{14,15,16}、PBA 分子鎖が d-PS 膜に比べて拡散しにくいからだと考 えられた。しかし、剥離試験では、界面厚が薄いとされる PS 吸着層上の剥離強 度の方が大きい結果であった。これより、PS 吸着層上の剥離強度は界面厚だけ でなく、PS 吸着層の分子鎖凝集状態に起因する運動性の低さも影響していると 考えられる。

また、界面幅の厚みの理論値を算出した。界面厚み(*L*)は、Helfand-Tagamiの統計力学的論¹⁷⁾によって、Flory-Huggins の χ パラメーター¹⁸⁾および、セグメント長 *l* と式(4-8)で示されるような関係を持つ¹⁹⁾。

$$L \approx \frac{2}{\sqrt{6}} l \chi^{-0.5} \qquad (4-8)$$

PS/PBAの界面厚み(*L*)は、ポリスチレンのセグメント長(*l*=0.46 nm)およびPS/PBA の相互作用パラメータ($\chi_{PS-PBA}=0.01$)¹⁸⁾を用いて算出した結果、3.8 nm であった。 この結果は、NR 測定により得られた界面幅の厚みと異なる値であった。しかし、 この近似式は、2 つの非混和性高分子間の界面で予想される、界面近傍での鎖の コンフォメーションの変化、界面での鎖端の濃縮を考慮していない²⁰⁾。本研究 で得られた界面幅は、PS と PBA の分子運動性の違いに由来する非対称界面を SLD 値の変化により算出したため、Helfand-Tagami の近似式により得られた界 面厚みの理論値よりも大きくなったと考えられる。

4-6 まとめ

NR 測定により、d-PS 膜および d-PS 吸着層と粘着剤主成分である PBA の界面 構造を評価した。72 h の接触時間により、d-PS 膜/PBA および d-PS 吸着層/PBA いずれにおいても、被着体(d-PS)/粘着剤(PBA)の界面相の形成が確認された。こ れにより、基板に多点吸着している d-PS 吸着鎖においても PBA 分子鎖との絡 み合いが示唆され、この結果は、第三章に記述した、PS 膜上および PS 吸着層上 における剥離強度の経時変化は、PS 分子鎖と粘着剤分子鎖の絡み合いが影響し ていると考察された結果を支持している。

d-PS 吸着層/PBA の界面厚は d-PS 膜/PBA よりも3分の1程度であるが、界面 における PS の体積分率は d-PS 膜/PBA より大きいことが確認され、d-PS 吸着層 は分子鎖運動性が低く PBA が拡散しにくいことが示唆された。これらの結果よ り、剥離強度は PS/粘着剤の界面厚だけでなく、界面における分子鎖運動性の低 さも影響していると考えられる。

次章では、PSA テープ剥離面の状態を評価することでこれまでの考察をより 確かなものにしていく。

4-7 参考文献

- B. B. Sauer, D. J. Walsh, *Macromolcules*, 24, 5948-5955 (1991)., DOI: 10.1021/ma00022a009.
- K. Shimokita, I. Saito, K. Yamamoto, M. Takenaka, N. L. Yamada, T. Miyazaki, Langmuir, 34, 2856-2864 (2018)., DOI: 10.1021/acs.langmuir.7b03860.
- K. Mitamura, N. Yamada, H. Sagehashi, N. Torikai, H. Arita, M. Terada, M. Kobayashi, S. Sato, S. Goto, M. Furusaka, T. Oda, M. Hino, H. Jinnai, A. Takahara, *The International Journal for the Science and Technology of Polymers*, 45, 100-108 (2013)., DOI: 10.1038/pj.2012.156.
- K. Mitamura, N. Yamada, H. Seto, N. Torikai, T. Sugita, M. Furusaka, A. Takahara, *Journal of Physics: Conference Series*, **272**, 012017-1-4 (2011)., DOI: 10.1088/1742-6596/272/1/012017.
- N. Andrew, Journal of Physics: Conference Series, 251, 012094 (2010)., DOI: 10.1088/1742-6596/251/1/012094.
- J. A. Forrest, K. Dalnoki-Veress, Journal of Polymer Science: Part B: Polymer Physics, 39, 2664-2670 (2001)., DOI: 10.1002/polb.10019.
- P. M. Rauscher, J. E. Pye, R. R. Baglay, C. B. Roth, *Macromolecules*, 46, 9806-9817 (2013)., DOI: 10.1021/ma401498m.
- D. Feutas Siqueira, D. W. Schubert, V. Erb, M. Stamm, J. P. Amato, *Colloid & Polymer Science*, 273, 1041-1048 (1995)., DOI: 10.1007/BF00657671.
- A. R. John, B. B. William, W. Arnold, *Physical Properties. In Organic Solvents*, 2, 19–551 (1970).
- T. Chang, H. Zhang, X. Shen, Z. Hu, ACS Macro Letters, 8, 435-441 (2019)., DOI: 10.1021/acsmacrolett.9b00118.
- M. Inutsuka, K. Tanaka, *Journal of the Particle Accelerator Society of Japan*, 13, 202-207 (2016).
- M. Kobayashi, *Journal of the Adhesion Society of Japan*, **52**, 249-254 (2016)., DOI: 10.11618/adhesion.52.249.
- 13. T. Ougizawa, Journal of the Surface Science Society of Japan, 38, 55-60 (2017)., DOI: 10.11618/adhesion.53.77.
- N. Jiang, M. Sen, M. K. Endoh, T. Koga, E. Langhammer, P. Bjoorn, M. Tsige, Langmuir, 34, 4119-4209 (2018)., DOI: 10.1021/acs.langmuir.8b00122.

- M. J. Burroughs, S. Napolitano, D. Cangialosi, R. D. Priestley, *Macromolecules*, 49, 4647-4655 (2016)., DOI: 10.1021/acs.macromol.6b00400.
- K. Tanaka, Y. Tateishi, Y. Okada, T. Nagamura, *The Journal of Physical Chemistry B*, **113**, 4571–4577 (2009)., DOI: 10.1021/jp810370f.
- 17. E. Helfand, Y. Tagami, *Journal of Polymer Science: Part B: Polymer Physics*, **34**, 1947-1952 (1996)., DOI: 10.1002/polb.1996.930.
- A-V. Ruzette, S. T-Giraut, L. Leibler, F. Chauvin, D. Bertin, O. Guerret, P. Gérard, Macromolecules, 39, 5804-5814 (2006).
- Y. Shigeru, E. Kamei, *The Society of Reology, Japan*, 23, 103-108 (1995)., DOI: 10.1678/rheology1973.23.2_103.
- D. F. Siqueira, D. W. Schubert, V. Erb, M. Stamm, J. P. Amato, *Colloid and Polymer Science*, 273, 1041-1048 (1995)., DOI: 10.1007/BF00657671.

第五章

原子間力顕微鏡(AFM)および接触角(CA)計を用いた

PSA テープ剥離面の評価

5-1 緒言

PSA テープ剥離強度の評価において、前章で記述した、PSA と被着体の界面 構造だけでなく、剥離様式や界面密着性も大きな要素となるため、PSA テープ 剥離後の被着体表面状態を評価することが重要となってくる。表面観察法とし て、X線光電子分光法(X-ray Photoelectron Spectroscopy; XPS)や、飛行時間型二次 イオン質量分析(Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry; TOF-SIMS)が挙 げられる。しかし、XPS は数 10~数 100 nm 以上のスケールには対応している が、数 nm スケールを得意としない¹⁾。また、TOF-SIMS は数 nm の厚み方向の 評価が可能であるが、平面方向(XY 方向)での分解能が μm オーダーとなり、 平面方向の nm オーダーな情報が埋もれてしまう可能性がある。前章より、 PS/PSA 界面は数 nm~数十 nm スケールでの界面相を形成していることが示唆 されたため、剥離面観察において、平面方向、垂直方向のいずれも nm スケール で評価できる手法が求められた。そこで、近年表面形状を測定する装置として、 標準的手法となった原子間力顕微鏡(Atomic Force Microscope; AFM)を用いた²⁻⁴⁾。 AFM とは、カンチレバーと呼ばれる板バネに曲率半径が 10 nm 程度の小さな探 針をつけたもので、探針と試料表面との間の相互作用力(引力もしくは斥力)を 検出し、nm スケールでの表面構造解析を行う走査プローブ顕微鏡(SPM)の一種 である^{5,0}。AFM には様々なモードがあり、特にカンチレバーのたわみ量から相 互作用力を検出するコンタクトモードと、カンチレバーを共振周波数近傍で振 動させ、相互作用力によって振動振幅を検出するダイナミック・フォース・モー ド(DFM)に大別される。DFM はタッピングモードとして認識されている場合も あり、コンタクトモードに比べて走査時の試料へのダメージを低減できる⁷⁾。本 実験では柔らかい試料である PSA を用いているため、DFM による測定を行っ た。更に、剥離面における糊残りの評価として、対水接触角測定を用いた例^{8)も}

三重大学大学院 工学研究科

多い。そのため、本章でも、AFM と対水接触角測定を用いた被着体における剥 離面の形状観察と糊残りの評価を行い、剥離強度とそれらの関係を明らかにし た。

5-2 実験手順

5-2-1 PSA テープ剥離面における表面形状の観察

AFM を用いて、各試料における PSA テープ剥離面の表面形状の観察を行った。カンチレバーはシリコン製の SI-DF3(共振周波数 26 kHz、ばね定数 1.8 N/m、 先端径 10 nm)を使用した。モードはタッピングモード DFM を用いた。PS と PSA の吸着力に起因する位相差より、糊残りを評価した。

5-2-2 フォースディスタンス(FD)カーブ測定による糊残りの評価

AFM の FD カーブ測定により、試料と探針間に作用する凝着力を測定した。 カンチレバーはシリコン製の SI-AF01(共振周波数 16 kHz、ばね定数 0.27 N/m、 先端径 10 nm)を使用した。FD 測定は、試料-探針間の距離を変化させた際にカ ンチレバーに働く斥力(硬さ)と引力(凝着力)を測定する方法であり、剥離前 の試料と剥離後の試料の、カンチレバーに与える最大凝着力の違いから、糊残り を評価した。FD 測定は、引き離し量 300 nm、押し込み量-50 nm、測定時間 10 sec の条件で行い、20 μm×20 μm の範囲でアトランダムに 10 点測定した。

5-2-3 対水接触角測定による糊残りの評価

接触角計を用いて、各試料における PSA の糊残りを評価した。プローブ液体 として 2-1-6 で記述した超純水を用いて、測定条件は滴下量 2.0 μL、気温 25 °C、 相対湿度 35 %で行われた。

5-2-4 膜厚測定による糊残りの評価

エリプソメーターを用いて、PSA テープ剥離後における PS 膜および PS 吸着 層の膜厚を測定した。スペクトル測定条件は入射角 45.0 °、バンド幅 1.0 nm、 レスポンス 0.5 sec、開始波長 300 nm、終了波長 800 nm、データ取り込み間隔 2 nm、分解能 0.1 nm で測定を行った。

5-3 結果と考察

5-3-1 PSA テープ剥離面の糊残りの評価

5-2-1 に記述した条件で PSA テープ剥離面の AFM 観察を行った。



Figure 5-1. 貼付荷重 1 kg、貼付時間 24 h における各試料の PSA テープ剥離面の 表面形状像(走査範囲 20 μm×20 μm): (a) PS 膜、(b) PS 吸着層、(c) Si 基板.

Figure 5-1 に貼付荷重 1 kg、貼付時間 24 h における PS 膜、PS 吸着層および Si 基板の PSA テープ剥離面の表面形状像を示した。Figure 2-4 および Figure 2-5 で 示したテープ貼付前の PS 膜および PS 吸着層の形状像と比較すると、表面が粗 く、所々に島状の凸部が確認された。特に、Si 基板におけるテープ剥離面におい ては顕著に凸部が確認されたため、凸部は粘着剤の糊残りであると考えられた。

テープ剥離面に確認された凸部が糊残りであるかを DFM 測定により得られ る位相像より評価した。凸部の位相像を詳細に測定するために走査範囲は 5 µm×5µm で行った。本研究の AFM 測定は、DFM モードで測定をしているため、 探針が試料表面に接触した際のカンチレバー振動の入力信号と出力信号の位相 の差より試料表面の吸着力を評価することができ、試料の吸着力が強くなると 位相が遅れ、明るく表示される[®]。また、形状像において、コントラストの明部 は高い構造を反映している。



Figure 5-2. 貼付荷重 1 kg、貼付時間 24 h における各試料の PSA テープ剥離面の 形状像(左側)および位相像(右側)(走査範囲 5 µm×5 µm): (a)(a') PS 膜、(b)(b') PS 吸着層、(c)(c') Si 基板.

Figure 5-2 より、いずれの試料においても形状像で高いところは位相でも明る く表示されている。よって、形状像における凸部(明部)は柔らかい粘着剤であ ることが示唆された。また、糊残りが島状であるのは粘着剤の剥離における糸曳 き現象に由来するものと考える⁹。 糊残りの PSA テープ貼付時間を確認するために、貼付時間におけるテープ剥離面の表面形状の違いを確認した。



Figure 5-3. 貼付荷重 1 kg、各貼付時間における PS 膜の PSA テープ剥離面の形 状像および RMS 値(走査範囲 20 μm×20 μm):貼付時間(a) 5 min、(b) 24 h、(c) 48h、(d) 72 h.



Figure 5-4. 貼付荷重 1 kg、各貼付時間における PS 吸着層の PSA テープ剥離面の形状像および RMS 値(走査範囲 20 µm×20 µm):貼付時間(a) 5 min、(b) 24 h、(c) 48h、(d) 72 h.



Figure 5-5. 貼付荷重 1 kg、各貼付時間における Si 基板の PSA テープ剥離面の 形状像および RMS 値(走査範囲 20 µm×20 µm):貼付時間(a) 5 min、(b) 24 h、(c) 48h、(d) 72 h.

Figure 5-3 および Figure 5-4 より PS 膜と PS 吸着層の PSA テープ剥離面における糊残り(凸部)の範囲は貼付時間が長いほど少なく、表面粗さも貼付時間が長いほど小さくなっていることが確認された。一方で、Figure 5-5 より、Si 基板の PSA テープ剥離面における糊残りに顕著な貼付時間依存性は確認できなかった。

次に、糊残りをより詳細に評価するために走査範囲を 5 μm×5 μm に狭めて貼 付時間におけるテープ剥離面の表面形状の測定を行った。



Figure 5-6. 貼付荷重1 kg、各貼付時間における PS 膜の PSA テープ剥離面の形 状像および RMS 値(走査範囲 5 µm×5 µm):貼付時間(a) 5 min、(b) 24 h、(c) 48 h、(d) 72 h.



Figure 5-7. 貼付荷重 1 kg、各貼付時間における PS 吸着層の PSA テープ剥離面の形状像および RMS 値(走査範囲 5 μm×5 μm):貼付時間(a) 5 min、(b) 24 h、(c) 48 h、(d) 72 h.



Figure 5-8. 貼付荷重 1 kg、各貼付時間における Si 基板の PSA テープ剥離面の 形状像および RMS 値(走査範囲 5 µm×5 µm):貼付時間(a) 5 min、(b) 24 h、(c) 48 h、(d) 72 h. また、貼付荷重 100 g においても走査範囲を 5 μm×5 μm で貼付時間における テープ剥離面の表面形状の測定を行った。



Figure 5-9. 貼付荷重 100g、各貼付時間における PS 膜の PSA テープ剥離面の形 状像および RMS 値(走査範囲 5 µm×5 µm):貼付時間(a) 5 min、(b) 24 h、(c) 48 h、(d) 72 h.



Figure 5-10. 貼付荷重 100 g、各貼付時間における PS 吸着層の PSA テープ剥離 面の形状像および RMS 値(走査範囲 5 μm×5 μm):貼付時間(a) 5 min、(b) 24 h、(c) 48 h、(d) 72 h.



Figure 5-11. 貼付荷重 100g、各貼付時間における Si 基板の PSA テープ剥離面の 形状像および RMS 値(走査範囲 5 µm×5 µm):貼付時間(a) 5 min、(b) 24 h、(c) 48 h、(d) 72 h. Figure 5-6 から Figure 5-11 より、走査範囲 5 µm×5 µm で観察した場合において も、走査範囲 20 µm×20 µm で観察した際と同様に、PS 膜と PS 吸着層の PSA テ ープ剥離面における糊残り(凸部)の範囲は貼付時間が長いほど少なく、表面粗 さも貼付時間が長いほど小さくなる傾向が確認された。また、剥離面観察による 糊残りの貼付時間依存性は確認できなかった。

以上の結果より、テープ剥離面結果とテープ剥離強度の相関について考察を する。長い貼付時間において剥離面の凸部領域が少なくなったのは、糊残りがな くなったのではなく、PS分子鎖と粘着剤分子鎖の絡み合いによる粘着剤の凝集 破壊が起きていると考える。長い PSと粘着剤の接触により、PS分子鎖と粘着 剤分子鎖が絡み合い、界面密着性が増加したことで剥離時に粘着剤の凝集破壊 が起き、膜全体を糊残りが覆ったと考えられる。対照に、Si基板上においては分 子鎖の絡み合いは発生しないため、糊残りのテープ貼付時間依存性が確認でき なかったと考える。なお、本実験によっては PS 膜と PS 吸着層の剥離強度の差 をテープ剥離面から評価することはできなかった。 次に、テープ剥離面において、凸部が観察されない領域の表面粗さを評価した。PS 膜および PS 吸着層表面における、PSA テープの剥離による表面形状の変化を Figure 5-12 および Figure 5-13 に示した。なお、テープ剥離後の試料は貼付荷重 1 kg、貼付時間 24 h の条件で剥離試験を行った。



Figure 5-12. PS 膜表面におけるテープ剥離前と剥離後の表面形状像と断面プロ ファイル: (a) PSA テープ貼付前、(b) PSA テープ剥離後.



Figure 5-13. PS 吸着層表面におけるテープ剥離前と剥離後の表面形状像と断面 プロファイル: (a) PSA テープ貼付前、(b) PSA テープ剥離後.

Figure 5-12 と Figure 5-13 より、PS 膜および PS 吸着層の剥離前後で表面粗さが変化し、剥離後の粗さが大きくなることが確認された。PS 吸着鎖は基板界面に多点吸着しており、表面が隆起するとは考えにくいため、表面粗さの増大はPS を覆った糊残りを観察していると推察できる。

5-3-2 フォースディスタンス(FD)カーブ測定による糊残りの評価

PSA テープ貼付前と剥離後における、**PS** 膜および **PS** 吸着層の FD 測定結果 を Figure 5-14 および Figure 5-15 に示した。なお、テープ剥離後の試料は、貼付 荷重 1 kg、貼付時間 72 h の条件で剥離試験を行った。



Figure 5-14. PS 膜の FD 測定結果((a):PSA テープ貼付前、(b):PSA テープ剥離後).


Figure 5-15. PS 吸着層の FD 測定結果((a):PSA テープ貼付前、(b):PSA テープ剥離後).

Figure 5-14 および Figure 5-15 より、PSA テープ貼付前に比べ、PSA テープ剥離 後は、顕著に探針に働く凝着力が大きいことが確認された。また、探針に働く斥 力は、各試料で顕著な違いがないことが確認された。これは、試料の膜厚が薄い ため、基材である Si 基板の硬さの影響を強く受けていると考えられる。 次に、Figure 5-14 および Figure 5-15 より求めた、各試料の最大凝着力を Table 5-1 にまとめた。なお、neat は PSA テープ貼付前を示している。

	テープ貼付時間	最大凝着力 [nN]
PS膜	neat	22.6 ± 1.6
	72 h	39.0 ± 2.0
PS吸着層	neat	23.7 ± 2.1
	72 h	42.2±2.9

Table 5-1. 各試料における最大凝着力.

Table 5-1 より、テープ剥離面はテープ貼付前と比較して最大凝着力が大きいこ とが確認された。凝着力の増加は粘着剤の糊残りを反映していると考えられる ため、この結果より、テープ剥離面には全体的に糊残りがあると判断することが できる。

5-3-3 対水接触角測定による糊残りの評価



Figure 5-16. PS 膜上の PSA テープ剥離面における対水接触角(貼付荷重:1kg、貼付時間:neat、5 min、24 h、48 h、72 h).



Figure 5-17. PS 吸着層上の PSA テープ剥離面における対水接触角(貼付荷重: 1 kg、貼付時間: neat、5 min、24 h、48 h、72 h).



Figure 5-18. Si 基板上の PSA テープ剥離面における対水接触角(貼付荷重:1kg、貼付時間:neat、5min、24h、48h、72h).



Figure 5-19. PS 膜上の PSA テープ剥離面における対水接触角(貼付荷重:100 g、貼付時間: neat、5 min、24 h、48 h、72 h).



Figure 5-20. PS 吸着層上の PSA テープ剥離面における対水接触角(貼付荷重: 100 g、貼付時間: neat、5 min、24 h、48 h、72 h).



Figure 5-21. Si 基板上の PSA テープ剥離面における対水接触角(貼付荷重:100g、貼付時間:neat、5 min、24 h、48 h、72 h).



Figure 5-22. PSA テープの対水接触角.

Figure 5-16 から Figure 5-21 に、各条件における PSA テープ剥離面の対水接触 角の写真をそれぞれ示した。なお、貼付時間における neat は、PSA テープ貼付 前の各試料の状態を示した。また、Figure 5-22 に PSA テープの対水接触角の結 果を示した。接触界面が不明瞭なのは、剥離面が基板の手前端より奥側だからで ある。また、Table 5-2 および Table 5-3 に、対水接触角の測定値をそれぞれ示し た。

試料	PSAテープ貼付時間				
	neat	5 min	24 h	48 h	72 h
PS膜	93.3 ± 2.66	94.1 ± 0.42	91.6 ± 1.06	91.8 ± 0.33	93.4 ± 0.68
PS吸着層	90.9 ± 1.88	93.1 ± 1.20	91.8 ± 0.74	92.0 ± 0.97	91.3 ± 1.37
Si基板	73.8 ± 0.82	70.1 ± 0.88	75.1 ± 1.17	79.3 ± 0.39	79.8 ± 0.88
PSA	106.7 ± 3.00	N/A	N/A	N/A	N/A

Table 5-2. 各試料上の PSA テープ剥離面における対水接触角(貼付荷重:1kg).

Table 5-3. 各試料上のPSA テープ剥離面における対水接触角(貼付荷重:100g).

試料	PSA テープ貼付時間				
	neat	5 min	24 h	48 h	72 h
PS膜	93.3±2.66	92.5 ± 2.11	91.3 ± 0.27	91.6 ± 1.11	93.7±0.77
PS吸着層	90.9 ± 1.88	92.0 ± 0.70	92.8 ± 0.12	91.4 ± 1.05	91.3 ± 1.30
Si基板	73.8 ± 0.82	72.7 ± 0.88	79.2 ± 1.04	82.8 ± 0.23	81.9 ± 0.004
PSA	106.7 ± 3.00	N/A	N/A	N/A	N/A

次に、Table 5-2 および Table 5-3 に基づき、各試料の PSA テープ剥離面における、対水接触角の PSA テープ貼付時間依存性を貼付荷重別で、Figure 5-23 および Figure 5-24 にそれぞれ示した。



Figure 5-23. PSA テープ剥離面における対水接触角(貼付荷重1kg).



Figure 5-24. PSA テープ剥離面における対水接触角(貼付荷重 100 g).

Figure 5-23 および Figure 5-24 より、PS 膜および PS 吸着層の PSA テープ剥離 面上での対水接触角は PSA テープ貼付前の対水接触角と顕著な違いは見られな かった。AFM 観察において、テープ貼付時間が長い場合の PS 膜上および PS 吸 着層上のテープ剥離面では粘着剤の凝集破壊が起きていると示唆されたため、 対水接触角は、PSA テープの対水接触角と同程度になると考えられたが、実際 の測定結果では、PSA テープ貼付前と剥離後で顕著な違いは確認されなかった。 対水接触角においては、固体の表面張力だけでなく表面形状も結果に強く影響 するため、AFM 観察と異なる結果が得られたと考える。また、実際に対水接触 角や目視による糊残りの評価と、AFM 測定による糊残りの評価では矛盾した結 果が得られる例も報告されている⁸⁾。Si 基板においては、貼付時間と共に対水接 触角が大きくなる傾向が確認された。これは、AFM 測定で確認された、Si 基板 と PSA テープの親和性の高さにより、島状の糊残りが多く存在し、高さ 10 nm 以上の凹凸構造が形成される結果を反映していると考える。毛管現象により微 細な凹の部分に水が入りにくく、水と島状の糊残りが点接着になったことで、接 触角が大きくなった(Cassie-Baxter 状態)⁹と考えられる。また、貼付時間 5 分 における Si 基板の剥離面における対水接触角が増加していない結果は、短い貼 付時間によって濡れが貼付時間 24 h 以降に比べて進行していないからと考えら れる。

5-3-4 膜厚測定による糊残りの評価

エリプソメーターを用いて、PSA テープ貼付前およびテープ剥離面の膜厚を 測定し Table 5-4 に示した。なお、neat は PSA テープ貼付前を示している。

Table 5-4. PSA テープの剥離による PS 膜および PS 吸着層の膜厚変化.

	膜厚 [nm]			
貼付時間	neat	24 h	48 h	72 h
PS膜	180.7 ± 0.52	181.5 ± 0.83	181.5 ± 0.18	182.0 ± 0.27
PS吸着層	10.8 ± 0.06	11.4 ± 0.10	11.2 ± 0.09	11.0 ± 0.08

Table 5-4 より、PS 膜および PS 吸着層いずれにおいても PSA テープの剥離により、約1nmの膜厚の増加が確認された。膜厚の増加は PSA テープの糊残りを反映していると考えられるため、この結果からも、PS 膜上および PS 吸着層上において、PSA テープ貼付時間が長い場合に、粘着剤の凝集破壊が起きることが示唆された。

5-4 まとめ

AFM 測定と対水接触角測定により、各試料における PSA テープ剥離面の糊残りの評価を行った。

AFM 測定では、DFM モードによる剥離面の位相像を観察することで、各試料 における PSA テープ剥離面の糊残りが存在すると示唆された。各試料のテープ 剥離面における糊残りの貼付時間依存性において、Si 基板上では貼付時間の剥 離様式に変化は見られなかったが、PS 膜および PS 吸着層上では糊残りと見ら れる凸部が観察されなくなる傾向が確認された。これは、糊残りがなくなったの ではなく、長い貼付時間において、PS 分子鎖と粘着剤分子鎖が絡み合い、界面 密着性が増加したことで剥離時に粘着剤の凝集破壊が起き、膜全体を糊残りが 覆ったと考えられた。PS 膜および PS 吸着層表面における、テープ剥離面の表 面粗さはテープ貼付前の膜表面よりも大きくなることが確認された。PS 吸着鎖 は基板界面に多点吸着しており、表面が隆起するとは考えにくいため、観察され た表面粗さの増大は PSを覆った糊残りを観察していると推察され、この結果は、 FD 測定により得られた結果からも支持されている。これらの AFM を用いた剥 離面観察結果より、テープ貼付時間が長くなることで PS 分子鎖と粘着剤分子鎖 の絡み合いがおきていることが示唆され、この結果は、剥離強度試験および NR 測定から導かれる結果ともよく一致している。

対水接触角測定では、PS 膜および PS 吸着層の PSA テープ剥離面上での対水 接触角において PSA テープ貼付前の対水接触角と顕著な違いは見られなかった が、Si 基板においては、島状の糊残りによる接触角の上昇が確認された。

5-5 参考文献

- T. Yamashita, P. Hayes, *Applied Surface Science*, 254, 2441-2449 (2008)., DOI: 10.1016/j.apsusc.2007.09.063.
- G. Bining, C. Quate, C. Gerber, *Physical Review Letters*, 56, 930 (1986)., DOI: 10.1103/PhysRevLett.56.930.
- K. Nakajima, K. Ryu, M. Ito, S. Fujinami, *Journal of the Vacuum Society of Japan*, 56, 258-266 (2013)., DOI: 10.3131/jvsj2.56.258.
- K. Nakajima, S. Fujinami, T. Nishi, *Japanese Society of Microscopy*, 44, 145-148 (2009)., DOI: 10.11410/kenbikyo.44.2_145.
- R. Wiesendanger, Scanning Probe Microscopy and Spectroscopy, (1994)., DOI: 10.1017/CBO9780511524356.
- T. Ichii, Journal of the Surface Finishing Society of Japan, 59, 806-811 (2008)., DOI: 10.4139/sfj.59.806.
- K. Kobayashi, H. Yamada, *The Biophysical Society of Japan*, 56, 234-237 (2016)., DOI: 10.2142/biophys.56.234.
- 8. 生井 勝康, 接着の技術, 40, 22-31 (2020).
- A. B. D. Cassie, S. Baxter, *Transactions of the Faraday Society*, 40, 546 (1944)., DOI: 10.1039/TF9444000546.

第六章

総括

本論文では、バルクと異なる吸着層の分子鎖凝集状態に着目し、感圧接着テー プを用いた180度剥離試験に基づき、PS吸着層の表面におけるテープ剥離挙動 の経時変化観察、および、接着界面のNR測定や剥離面のAFM観察に基づき、 分子鎖凝集状態と剥離強度の関係を議論した。

180 度剥離試験より、テープ貼付から24時間以降に剥離した場合、PS 膜上と 比較して、PS 吸着層上のテープ剥離強度が大きいことが確認され、高分子鎖が 存在しない Si 基板上の剥離強度が増加していないことから、PS 分子鎖と粘着剤 分子鎖の相互拡散による絡み合いが影響していることが推察された。

さらにNR 測定より、d-PS 膜/PBA 界面および d-PS 吸着層/PBA 界面のいずれ においても、被着体(d-PS)/粘着剤(PBA)の界面相の形成が確認された。また、d-PS 吸着層/PBA 界面厚が d-PS 膜/PBA 界面厚よりも薄かったことより、吸着層の 分子鎖凝集状態に由来する分子鎖のモビリティの低さが剥離強度に影響を与え ていると示唆された。

AFM によるテープ剥離面観察では、各試料上に糊残りが確認された。また、 テープ剥離面における糊残りのテープ貼付時間依存性が確認され、PS 分子鎖と 粘着剤分子鎖の絡み合いによる界面密着性の上昇で説明された。

以上の結果より、PS 膜と PS 吸着層の異なる分子鎖凝集状態を反映した界面 相の形成状態においては、基板と吸着鎖が多点吸着していることに起因する剥 離強度の違いが顕れると結論できる。しかし、粘着剤由来と考えられる初期接着 における剥離強度の増減については未解明な部分があるため、今後詳細に追跡 していく必要がある。

謝辞

本研究を進めるにあたって多大なるご助言、ご指導いただきました鳥飼直也 教授に厚く御礼申し上げます。また、本研究の担当であり実験を進めていくう えで多くのご指導をいただいた藤井義久 准教授、器具の注文・薬品の管理など でお世話になった藤田由紀子 様には深く感謝申し上げます。

本研究を遂行するにあたり、力学試験機を使用させて頂きました無機素材化 学研究室の橋本忠範 准教授に心より感謝申し上げます。

また、中性子反射率測定のデータ解析において、高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所 量子ビーム連携研究センターの山田悟史 准教授に深く御 礼申し上げます。

互いに切磋琢磨しながら研究活動を進めてきました、小川凌央さんをはじめとする有機素材化学研究室の卒業生、在学生の皆様に深く感謝申し上げます。

最後に、有意義な学生生活・研究生活を送るに際し、様々な面でご支援いた だきました両親に心より感謝いたします。